



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

МАГНА ТМ 7

Назначение:

Нанесение плёнок металлов, резистивных материалов и диэлектриков методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Количество МРУ в установке - 2шт.;
- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
60x48 - 17 шт.;
- Нагрев подложек до 300°C;
- Контроль толщины резистивной пленки по сопротивлению;
- Количество ионных источников - 1шт.;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (ТМН1300);
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 3 м².

